## 垂直ブリッジマン法で成長した高純度 Mg<sub>2</sub>Si 結晶の結晶性評価 Characterization of high purity Mg<sub>2</sub>Si crystals grown by vertical Bridgman method °中野 浩平、大坪 翼、今野 嵩、鵜殿 治彦 (茨城大学)

°Kohei Nakano, Tsubasa Otsubo, Shu Konno, Haruhiko Udono (Ibaraki University)
E-mail:udono@vc.ibaraki.ac.jp

[結果と考察] 図 1 に成長した高純度  $Mg_2Si$  結晶の代表的な写真を示す。クラックの無い、良好な結晶が得られている。この結晶の密度を測定したところ  $1.99g/cm^3$  であり、 $Mg_2Si$  の理論密度  $1.988g/cm^3$  とほぼ同じであった。Hall 効果測定によって得られた本結晶の電子密度は  $8.0\times10^{15}cm^3$  であり、これ以外の結晶の測定結果を含めて $(6-8)\times10^{15}cm^3$  の高純度結晶を得ることができた。また、結晶の粉末 XRD 測定を行ったところ  $Mg_2Si$  以外の Mg、Si などに起因する回折ピークも見られなかった。次に、成長方向に垂直面で結晶を切り出し、XRD 測定により結晶の成長方位を調べた。図 2(a), (b)は結晶#1 と#2 の測定結果である。これらから成長方位は成長結晶によって異なり、<100>と<110>があることがわかった。

[まとめ]垂直ブリッジマン法を用いて高純度  $Mg_2Si$  結晶を成長し、その評価を行った。成長させた結晶の電子密度は、 $(6-8)\times10^{15} \text{cm}^{-3}$ で、成長方位は<100>と<110>があることがわかった。

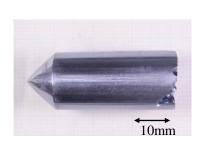
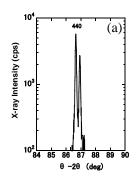


図 1.高純度 Mg<sub>2</sub>Si 結晶写真



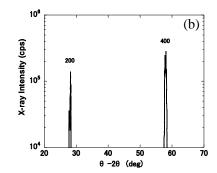


図 2. XRD 測定結果

[参考文献][1] D.Tamura et al., Thin Solid Films, 515(2007)8272.

[2] H. Udono et al., Jpn.J.Appl.Phys.,54, (2015) 07 JB06. [3] H. Udono et al., J. Phys. Chem. Sol., 74(2013)311.

[4] K.Kambe, H.Udono, J.Electron.Mat.,43(2014) 2212. [5] A. Kato et al., J. Phys.: Condens. Matter 21(2009)20581. [**謝辞**]本研究の一部は、科学研究費補助金(25289081)の補助を受けて行った。